

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成20年10月2日(2008.10.2)

【公開番号】特開2008-177289(P2008-177289A)

【公開日】平成20年7月31日(2008.7.31)

【年通号数】公開・登録公報2008-030

【出願番号】特願2007-8306(P2007-8306)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/31 (2006.01)

H 0 1 L 21/683 (2006.01)

C 2 3 C 16/46 (2006.01)

H 0 1 L 21/205 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/31 E

H 0 1 L 21/68 N

C 2 3 C 16/46

H 0 1 L 21/205

【手続補正書】

【提出日】平成20年8月15日(2008.8.15)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 7】

少なくとも前記膜を形成する際に、膜形成部位に光を照射する光源をさらに有することを特徴とする請求項 2 から請求項 6 のいずれか 1 項に記載の基板処理装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 2 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 2 2】

少なくとも前記膜を形成する際に、膜形成部位に光を照射し、成膜しつつある膜の電気抵抗を低下させることを特徴とする請求項 1 7 から請求項 2 1 のいずれか 1 項に記載の基板処理方法。